



بررسی تاثیر نانوفلاکسهای MgO، SiO₂ و ZnO بر خواص جوشکاری با گاز محافظ آلومینیوم ۷۰۷۵

مسلم پایدار*'، مجتبی جعفریان'، صاحبعلی منافی' و سید شهابالدین طباطبایی نائینی'

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی مواد، تهران، ایران
 ۲- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی مواد، شاهرود، ایران

تاريخ ثبت اوليه: ١٣٩٢/١٠/١١، تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده: ١٣٩٢/١١/٢٤، تاريخ پذيرش قطعى: ١٣٩٢/١٢/٢٠

چکیدہ

در این پژوهش تاثیر انواع نانوفلاکسهای فعال بر روی عمق نفوذ، عرض و ریزساختار جوش توسط فرآیند جوشکاری با گاز محافظ تیگ بر روی آلومینیوم ۲۰۷۵ با ضخامت ۵ mm ۵ مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بیشترین و کمترین میزان عمق نفوذ به ترتیب مربوط به نانوفلاکس SiO₂ و حالت بدون فلاکس میباشد. نانوفلاکسهای SiO₂ و SiO و ZnO به ترتیب میزان عمق نفوذ به ترتیب مربوط به جوشکاری بدون استفاده از نانوفلاکس به ترتیب ۲۵۵٪، ۹۷٪ و ۸۴٪ افزایش دادند. سطح ظاهری جوشها با افزودن نانوفلاکس تغییر کرده و ریزدانهترین ساختار در ناحیه متاثر از حرارت مربوط به نانوفلاکس SiO₂ بود. همچنین بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از سطح مقطع جوش نشان داد که در اثر وزش قوس و جابجایی مذاب، نانوفلاکس به سمت کنارههای جوش جابجا میشود.

واژههای کلیدی: فر آیند جوشکاری با گاز محافظ، نانوفلاکس اکسیدی، آلومینیوم ۲۰۷۵.

۱– مقدمه

آلیاژهای آلومینیوم بطور وسیعی در صنایع پیشرفته به واسطه ویژگیهای خاصی که دارا میباشند از جمله چگالی کم و مقاومت به خوردگی بالا مورد استفاده قرار میگیرند. جریان تناوبی (AC) و جوشکاری تنگستن با گاز محافظ (AC) و مقاومت به خوردگی بالای ترسوم ترین فرآیند برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم است [۳–۱]. مزیتهای جوشکاری تیگ (TIG) از جمله کیفیت متالورژیکی بالای جوش و خواص مکانیکی خوب میباشند با وجود این مزیتها، محدودیتهایی در این فرآیند و بازدهی تولید

کم می باشد. این محدودیت اقتصادی زمانیکه با فرآیند

جوشکاری قوس با الکترود مصرفی در مقاطع با ضخامت

بیش از mm ۲۰ مقایسه شود، توجیه اقتصادی دارد. از سوی دیگر تمایل به تولیدات با کیفیت بالاتر و بهرهوری بیشتر در سالهای اخیر منجر به توسعه گوناگون در فرآیند تیگ شده است [۶–۴]. در سالهای اخیر، فرآیند جوشکاری تیگ فعال شده (Activated-TIG: A-TIG) نام دارد [۷] توجه بیشتری به آن شده است که بطور قابل توجهی باعث بهبود نفوذ جوش توسط اعمال لایه ناز کی از نانوفلاکس فعال روی سطح جوش قبل از شروع جوشکاری تیگ می شود [۸]. استفاده از نانوفلاکسهای فعال در فرآیند جوشکاری تیگ در سال ۱۹۶۰ تحت عنوان روش

^{*} **عهدەدار مكاتبات:** مسلم پايدار

نشانی: تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مواد

تلفن: ۴۴۸۶۵۱۵۴-۲۱۰، دورنگار: ۴۴۸۰۴۱۸۱-۲۱۰، پستالکترونیکی: moslem_paidar@yahoo.com

تیگ فعال (Activated-TIG) شناخته شده است. در این روش، لایه نازکی از نانوفلاکس فعال روی سطح فلز پایه اعمال میشود. در طی جوشکاری، شرایط معین در قوس و ناحیه جوش منجر به افزایش عمق نفوذ جوش و افزایش بهرهوری در اتصال قطعات ضخیم خواهد شد، که در شکل ۱ شماتیک فرآیند و تاثیر آن بر روی هندسه جوش نشان داده شده است.



شکل ۱: شماتیکی از فرآیند الف) TIG و ب) A-TIG.

فرآیند جوشکاری تیگ فعال شده شامل دو مکانیزم میباشد: ۱- اثر جابجایی مارانگونی و ۲- رفتار قوس جوشکاری. هیپل و روپر گزارش کردهاند [۹] که سطح عناصر فعال در حوضچه مذاب باعث تغییر دمای ضریب کشش سطحی از منفی به مثبت خواهد شد، لذا باعث معکوس شدن جابجایی مارانگونی و در نتیجه باعث حرکت مذاب از بیرون به داخل خواهد شد. معکوس شدن حرکت مارانگونی باعث افزایش عمق نفوذ اتصال خواهد شد. لوکاس و همکارانش [۱۰] عمق نفوذ بیشتر در جوشکاری تیگ فعال شده را به انقباض قوس جوش نسبت دادهاند. در این رابطه لیو و همکاران [۱۱] بر روی تاثیر فلاکس کادمیم کلرید در جوشکاری تیگ فعال آلیاژهای منیزیم تحقیقاتی را صورت دادند و به این نتیجه رسیدند که در حضور فلاکس کادمیم کلرید عمق نفوذ به دو برابر حالت بدون استفاده از فلاکس افزایش می یابد. همچنین در پژوهش دیگری لیو و همکاران [۱۲] با استفاده از سیم

جوش یوشش داده شده با مخلوطی از کلرید منگنز و اکسید روی با روش تیگ به ایجاد جوشی بین آلیاژهای AZ31B منیزیم پرداخته و مشاهده نمودند که در حضور فلز یرکننده (هر گونه مواد مورد استفاده جهت اتصال دو قطعه فلز در حین جوشکاری یا لحیم کاری، که در حین جوشکاری ذوب شده و منجر به اتصال بین دو قطعه می شود) پوشش داده شده، نه تنها عمق نفوذ افزایش مى يابد بلكه بدليل مخلوط شدن مناسب قطرات مذاب با حوضچه مذاب در اثر مخلوط شدن آنها بوسیله قـوس درز جـوش مناسـبی تشـکیل مـیشـود. از طرفـی احمـدی و همکاران [۱۳] بر روی جوشکاری تیگ فولادهای زنگنزن آستنیتی 316L با استفاده از فلاکسهای TiO₂ و SiO₂ تحقیقاتی را صورت داده و به این نتیجه رسیدند که علاوه بر ايجاد عمق بيشتر نفوذ توسط فلاكس SiO₂، سختي و استحكام اتصال حاصل با این فلاكس نیز بیشتر از فلاكس TiO₂ خواهد بود. شیو و همکاران [۱۴] جوشـکاری تیـگ فعال شده بر روی آلومینیوم ۳۰۰۳ را مـورد بررسـی قـرار داده و طبق گزارشات در صورت استفاده از فلاکس نه تنها انقباض قوس بلکه سرباره تشکیل شده بر روی جوش پس از فرآیند نیز در افزایش هر چه بیشتر عمق نفوذ تاثیرگذار می باشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که تاثیر نانوفلاکس بر روی افزایش ولتاژ حدود ۱ تا ۲ ولت است که این افزایش ولتاژ نیز دلیلی بر افزایش نفوذ خواهد بود. سان و پن گزارش کردهاند [۱۵] کـه در جوشـکاری تیـگ فعال شده می توان انتظار افزایش بیش از ۳۰۰٪ در عمق نفوذ را نسبت به فرآیند جوشکاری تیگ معمولی داشت. در تمامی تحقیقات صورت گرفت در زمینه استفاده از فلاكس جهت افزایش عمق نفوذ از فلاكس هایی با اندازه ذرات در مقیاس میکرون استفاده شده، به همین منظور در این پژوهش سعی شد تا به بررسی تاثیر انواع نانوفلاکسهای فعال روی عمق نفوذ، عرض و ریزساختار جوش توسط فرآیند جوشکاری با گاز محافظ (تیگ) بر روی آلومینیوم ۷۰۷۵ با ضخامت mm ۵ پرداخته شود.

۲- فعالیتهای تجربی

ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی آلومینیوم ۷۰۷۵ مورد استفاده به ترتیب در جدولهای ۱ و ۲ آورده شده است.

29	۷
----	---









شکل ۲: تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نانوذرات، الف) SiO2 و ج) ZnO.



شکل ۳: وضعیت قرار گیری دستگاه و ابعاد ورقهها.

.(wt.%)	ىايە	فلز	بابى	شىم	كىب	ټ	:1	حدول
		-	5			~		U J

Alloy	Al	Cr	Mg	Mn	Zn
	base	۰/۲	۲/۶	۰/۱۵	۵/۶
۷۰۷۵	Cu	Fe	Si	Ti	-
	۱/۵	۰/۴۵	٠/١٢	۰/۰۳	-

يە	پا	فلز	مكانيكى	خواص	:۲	جدول
----	----	-----	---------	------	----	------

Alloy	استحکام کششی (MPa)	تنش تسليم (MPa)
	811	$\sim \Delta \lambda$)
۷۰۷۵	ازدیاد طول (٪)	سختی ویکرز (HV)
	11	١٩٠

ورقههایی با ابعاد mm ۱۵۰×۱۰۰×۵ جهت جوشکاری آماده شد. در این تحقیق تاثیر نوع نانوفلاکس در شرایط ثابت، جریان متناوب، سرعت جوشکاری ۲ mm/s، فاصله نوک الکترود تا ورق mm ، الکترود تنگستنی با قطر ۳/۲ mm مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اطمینان از نتایج بدست آمده، هر آزمایش سه بار تکرار شد و میانگین نتایج به عنوان نتیجه کلی گزارش شد. در آزمایشات صورت گرفته از فلز پرکننده استفاده نشد و جوشکاری در یک پاس به صورت ایجاد یک خط جوش بر روی صفحه آلومينيومي انجام شد. شکل ۲ تصاوير ميکروسکوپ الكترونى از پودرهاى مورد استفاده شامل MgO ،SiO₂ و ZnO می باشد. همانطور که ملاحظه می شود پودر های MgO ،SiO₂ و ZnO دارای اندازه دانهای به ترتیب در حدود ۳۰، ۴۰ و ۵۰ nm می باشند. به منظور اعمال پودر بر روی نمونهها، پودر توسط استون به صورت خمیـر در آورده شد و با قلمو بر روی ورق آلومینیومی حرکت داده شد. سیس نمونهها تحت شرایط ذکر شده جوشکاری شدند (شکل ۳). پس از جوشکاری سطح مقطع نمونههای جوشکاری شده آمادهسازی، سمباده و پولیش زده شد و توسيط محليول HCl 1/۵ ml ،H₂O ۹۵ ml) Keller توسيط HNO₃ ۲/۵ ml و HF ۱ ml) اچ شدند. سپس میزان عمق، عرض جوش و ریزساختار فلز جوش توسط میکروسکوپ نوري مدل Olympus CK40M، ميكروسكوپ استريو و ميكروسكوپ الكتروني روبشي مدل Leo 440i مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشهای ریزسختی بوسیله دستگاه ریزسختی سنج ویکرز، با بار اعمالی g ۵۰ و مدت زمان اعمال بار ۲۰ ثانیه صورت گرفت.



۳- نتايج و بحث

شکل ۴ تاثیر نانوفلاکس بر روی سطح ظاهری جوش را نشان میدهد. نانوفلاکسهای مختلف، سطوح ظاهری متفاوتی، خواهند داشت. سطح ظاهری جوشهای ایجاد شده با استفاده از نانوفلاکس SiO₂، کمی سیاه رنگ و باریکتر از سطح جوشهای ایجاد شده با پودرهای MgO و ZnO میباشد. این مسأله نشان دهنده انقباض بیشتر قوس در حین استفاده از نانوفلاکس SiO₂ بوده که در نتیجه آن افزایش جریان و ولتاژ قوس منجر به سیاهتر شدن خط جوش ایجادی شده است.





شکل ۴: تاثیر نانوفلاکس بر روی سطح ظاهری جوش در شرایط ثابت، الف) SiO₂ ب) ZnO و ج) MgO.

شکل ۵ تصاویر درشت ساختار از سطح مقطع جـوشهـای ایجـاد شـده توسـط نـانوفلاکسهـای مختلـف و بـدون نانوفلاکس را نشان میدهد. نانوفلاکسهای مختلف باعـث تغییر عمق نفوذ جوش و عرض جوش میشوند.





(ب)





شکل ۵: تصاویر درشت ساختار از سطح مقطع جوشهای ایجاد شده با استفاده از، الف) بدون نانوفلاکس، ب) SiO₂ ج) MgO و د)

همانطوریکه ملاحظه میشود نانوفلاکس SiO₂ باعث بیشترین مقدار عمق نفوذ شده است بطوریکه مقدار عمق نفوذ جوش نسبت به جوشکاری بدون نانوفلاکس حدود ۳۵۵٪ افزایش یافته است. در رابطه با مکانیزمی که منجر به افزایش عمق نفوذ میشود، میتوان به تجزیه نانوفلاکس اشاره نمود [۲۱–۱۶]. دمای بالا در ناحیه زیر قوس (حدود

R

$$SiO_{2(s)} = Si_{(s)} + O_{2(g)}$$

$$\Delta G^{0} = 902000 - 174T (T = 1700 \text{ K})$$
(1)

$$MgO_{(s)} = Mg_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$$

$$\Delta G^{0} = 729600 - 204T (T = 2200 \text{ K})$$
(7)

$$ZnO_{(s)} = Zn_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$$

$$\Delta G^{0} = 452920 - 244T \text{ (T = 1900 K)}$$
(7)

همانطوريكه ملاحظه مى شود نانوفلاكس SiO₂ نسبت به دو نانوفلاکس دیگر در دمای پایین تری تجزیه می شود و همین مسأله عامل اصلی در تراکم هـر چـه بیشـتر قـوس خواهد بود. چرا که مولکولهای اکسیدی بدست آمده از تجزیه نانوفلاکس، تمایل به اتصال به الکترون های آزاد اطراف پلاسمای قوس را دارند. در نتیجه جذب الکترون توسط این مولکولهای اکسیدی باعث تولید یونهای منفى ($O_2^{2-} \to O_2^{2-}$) با تحر ک پذيرى کم در اطراف قوس خواهند شد. در نهایت حضور این لایه اکسیدی در اطراف قوس، منجر به انقباض و جمع شدگی قوس و جلوگیری از اتلاف گرما بوسیله الکترونها میشود. تاثیر SiO₂ روی افزایش ولتاژ بیشتر از نانوفلاکس های دیگر است که این افزایش ولتاژ باعث افزایش عمق نفوذ جوش خواهد شد. شکل ۶ نشان دهنده مقدار کمی عمق و عرض جـوش در شـرایط اسـتفاده از نـانوفلاکسهـای مختلـف مى باشد.



شکل ۶: تاثیر نانوفلاکسهای فعال بر روی هندسه جوش.

در جدول ۳ مقادیر درصد افزایش عمق نفوذ آورده شده است.

جدول ۳: تاثیر نانوفلاکس اکسیدی بر روی هندسه جوش.

نوع پودر	نفوذ جوش (mm)	پهنای جوش (mm)	افزایش عمق نفوذ (٪)
بدون پودر	۰/٨۶	۱۰/۵	
MgO	١/٧	۹/۷	٩٧
SiO ₂	۳/۰۶	٧/۶٩	۲۵۵
ZnO	١/۵٩	٩/٣٩	٨۴

همانطور که در شکل ۶ نشان داده شده است، بیشترین عمق نفوذ به ترتیب مربوط به SiO2، MgO و بدون نانوفلاکس است که مطابق با جدول ۳ عمق نفوذ به ترتیب ۵۲٪، ۹۷٪ و ۸۴٪ نسبت به حالتی که از نانوفلاکس استفاده نشده است افزایش یافته است. نکته قابل توجه کاهش پهنای جوش با استفاده از نانوفلاکس SiO2 نسبت به نانوفلاکسهای MgO و ZnD است. عاملی که باعث تغییر در عمق نفوذ و پهنای جوش میشود، انقباض قوس است که در شکل ۷ این رفتار قوس با استفاده از نانوفلاکس SiO2 و بدون استفاده از نانوفلاکس نشان داده شده است.





شکل ۷: نمای روبرویی از ستون پلاسمای قوس، الف) بدون حضور نانوفلاکس و ب) با حضور نانوفلاکس SiO₂.

همراه با انقباض قوس، دانسیته جریان ورودی در مرکز آند (نقطه آند) افزایش یافته که باعث افزایش عمق نفوذ جوش می شود. ایـن رخـداد توسط Xing-hong و Qing-ming [۲7] نشان داده شده است کـه تجزیـه نـانوفلاکس فعـال باعث افزایش ولتاژ قوس خواهد شد. لذا میتوان گفت کـه یکی از دلایل افزایش عمق نفوذ توسط نـانوفلاکس SiO2 یکی از دلایل افزایش عمق نفوذ توسط نـانوفلاکس SiO2 است که اکسید سیلیسیم یک سرامیک اکسیدی است و یک کانال رسانا بین الکترود تنگستن و قطعه کار تشکیل ولتـاژ بررسی شـد و همانطـورکه انتظـار میرفت، استفاده از نانوفلاکس باعث افزایش ولتاژ شـد کـه ایـن افزایش ولتاژ باعـث افزایش حـرارت ورودی و در نتیجـه افزایش عمق و پهنای جوش شد (جدول ۴).

جدول ۴: تاثیر نانوفلاکس بر روی ولتاژ جوشکاری.

نوع فلاكس	ولتاژ قوس (V)	سختی فلز جوش (HV)
بدون نانوفلاكس	١٣	147
MgO	14	171
SiO ₂	18	٩٧
ZnO	14	١١٧

افزایش عمق نفوذ جوش با استفاده از نانوفلاکسها، نشان دهنده تمرکز بالای انرژی در طی فرآیند جوشکاری و همچنین تمایل به کاهش اعوجاج زاویهای قطعات جوشکاری را دارد. علاوه بر این حساسیت به تشکیل عیوب با استفاده از نانوفلاکسها کاهش خواهد یافت، علاوه بر این تاثیر دیگری که نانوفلاکسها دارا میباشند، کاهش سختی ناحیه جوش است، یعنی افزایش نانوفلاکس، باعث افزایش حرارت ورودی خواهد شد که به نییجه کاهش سختی فلز جوش را منجر خواهد شد. میزان تغییرات سختی در جدول ۴ آورده شده است. شکل ۸ نشان دهنده تاثیر نانوفلاکس SiO بر روی اندازه دانه میباشد. افزایش حرارت ورودی در اثر افزایش ولتاژ و در نتیجه افزایش رشد دانه در ناحیه جوش و کاهش اندازه دانه در ناحیه متاثر از حرارت رخ خواهد داد.







شکل ۸: تصاویر ریزساختار متاثر از حرارت و ناحیه جوش با استفاده از، الف و ب) بدون نانوفلاکس، ج و د) نانوفلاکس SiO2.

لازم به ذکر است از آنجائیکه ناحیه اصلی شکست در جوشها، ناحیه متاثر از حرارت است، لذا تمرکز یا همان انقباض قوس به وضوح بر روی ناحیه متاثر از حرارت تاثیر خواهد گذاشت (باعث حرارت ورودی کمتری به این ناحیه خواهد شد) که باعث ریز دانهتر بودن این ناحیه و در نتیجه بهبود استحکام کشش اتصال خواهد داشت. دلیل دیگری که فلاکسهای اکسیدی باعث افزایش نفوذ جوش میشوند را میتوان به تغییر کشش سطحی نسبت داد. شکل ۹ شماتیکی از حالتهای جریان گریز از مرکز مارانگونی و جریان مرکزگرای مارانگونی میباشد. در جوشچه جوش به کنارههای حوضچه خواهد بود که باعث میشود پهنای جوش زیاد شود که در شکل ۹–الف نشان داده شده است.





ولی وقتی از فلاکس استفاده می شود، بدلیل حضور اکسیژن دمای کشش سطحی (σ) در مذاب تغییر خواهد کرد و باعث مثبت شدن شیب تغییرات کشش سطحی با دما (dσ/dT) خواهد شد. از طرفی زمانیکه فلاکس مورد استفاده در مقیاس نانو باشد در این صورت بواسطه افزایش

سطح تماس ذرات با قوس و انجام سریعتر واکنش تبخیر جمع شدگی قوس نسبت به حالت استفاده از فلاکس در مقیاس میکرون بیشتر خواهد بود. کشش سطحی در مرکز حوضچه بالاتر از کنارهها خواهد بود که باعث خواهد شد حرکت معکوس جابجایی مارانگونی رخ دهد و مواد از کنارهها به سمت داخل سیلان کنند (شکل ۹-ب). شکل ۱۰ نشان دهنده تصاویر SEM از سطح مقطع جوش در حضور نانوفلاکس SiO₂ از مرکز و کنارههای سطح جوش میباشد.







شکل ۱۰: تصاویر SEM از، الف) سطح مقطع جوش در حضور نانوفلاکسSiO₂ ب) ناحیه A و ج) ناحیه B.

JR

همانطوریکه ملاحظه می شود تصاویر نشان دهنده سرباره باقیمانده اضافی در کنارههای سطح جوشکاری شده است و در مرکز جوش آثاری از نانوفلاکس مشاهده نمی شود. در تصویر ۱۰–الف نقاط A و B به ترتیب مربوط به مرکز و کنارههای جوش می باشند. در اثر ایجاد حرکت مارانگونی که در اثر اضافه کردن نانوفلاکس ایجاد می شود، ذرات فلاکس به کنارههای سطح جوش رانده خواهند شد.

۴- نتیجهگیری

در این پژوهش تاثیر انواع نانوفلاکسهای فعال روی عمق نفوذ، عرض و ریزساختار جوش توسط فرآیند جوشکاری با گاز محافظ (تیگ) آلومینیوم ۲۰۷۵ با ضخامت ۵ میلیمتر مورد بررسی قرار گرفت. پودرهای SiO₂، MgO و ZnO جهت بررسی ساختاری استفاده شد. طبق نتایج حاصل شده بیشترین میزان عمق نفوذ مربوط به نانوپودر SiO₂ و کمترین عمق نفوذ مربوط به خانوپودر SiO و کمترین عمق نفوذ مربوط به بانوپودر و SiO و میباشد. نانوفلاکس MgO، SiO و ZnO به ترتیب میزان میباشد. نانوفلاکس MgO، SiO و ZnO به ترتیب میزان عمق نفوذ جوش را نسبت به جوشکاری بدون استفاده از نانوفلاکس به ترتیب ۲۵۵٪، ۹۰٪ و ۸۴٪ افزایش دادند. از طرفی ریزدانهترین ساختار در ناحیه متاثر از حرارت مربوط نانوفلاکس به ترتیب SiO و استحکام کششی بیشتری را در پی داشت. استفاده از نانوفلاکس باعث افزایش ولتاژ جوشکاری خواهد شد که این افزایش ولتاژ باعث افرایش عمق نفوذ میشود.

مراجع

[1] J.H. Zhang, X.S. Lu, W. Yu, Development and Application of Materials, **15**, 2000, 1.

[2] A. Vaziri, M. Heydarzadeh Sohi, A. Safaei, *Surface and Coatings Technology*, **206**, 2012, 3788.

[3] S.P. Lu, M.P. Qin, W.C. Dong, Journal of Materials Processing Technology, 213, 2013, 229.

[4] P. Vasantharaja, M. Vasudevan, *Journal of Nuclear Materials*, **421**, 2012, 117.

[5] L. Dongjie, L. Shanping Lu, D. Wenchao, L. Dianzhong,
 L. Yiyi, *Journal of Materials Processing Technology*, 212, 2012, 128.

[6] K.H. Tseng, K.J. Chuang, *Powder Technology*, **228**, 2012, 36.

[7] K.H. Tseng, C.Y. Hsu, *Journal of Materials Processing Technology*, **211**, 2011, 503.

[8] G.I. Qin, G. Wang, Z. Zou, *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, **22**, 2012, 23.

[9] C.R. Heiple, J.R. Ropper, Weld. J., 61, 1982, 97.

[10] W. Lucas, D. Howse, Weld. Met. Fab., 64, 1996, 11.

[11] L. Liu, Z. Zhang, G. Song, Y. Shen, *Materials Transactions*, 47, 2006, 446.

[12] L.M. Liu, D.H. Cai, Z.D. Zhang, *Scripta Materialia*, **57**, 2007, 695.

[13] E. Ahmadi, A.R. Ebrahimi, *Journal of Advanced Materials and Processing*, **1**, 2012, 55.

[14] S.W. Shyu, H.Y. Huang, K.H. Tseng, C.P. Chou, J. Mater. Eng. Perfor., 17, 2008, 193.

[15] Z. Sun, D. Pan, Sci. Technol. Weld. Join., 9, 2004, 337.

[16] K.H. Tseng, C.Y. Hsu, Journal of Materials Processing Technology, **210**, 2010, 1.

[17] S. Lu, H. Fujii, K. Nogi, *Journal of Materials Processing Technology*, **209**, 2009, 1231.

[18] M. Fattahia, N. Nabhani, E. Rashidkhani, Y. Fattahi, S. Akhavan, N. Arabian, *Micron*, 54, 2013, 28.

[19] S. Tashiro, M. Miyata, M. Tanaka, *Thin Solid Films*, **519**, 2011, 7025.

[20] Y. Dongxia, L. Xiaoyan, N. Zuoren, H. Dingyong, H. Hui, Z. Guanzhen, *Rare Metal Materials and Engineering*, **41**, 2012, 1713.

[21] A.V. Birdeanu, C. Ciuca, A. Puicea, *Journal of Materials Processing Technology*, **212**, 2012, 890.

[22] L. Qing-Ming, W. Xin-Hong, *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, **17**, 2007, 486.

[23] S. Lv, Q. Cui, Y. Huang, X. Jing, Materials Science and Engineering: A, 568, 2013, 150.